



Order Patent



(19)

JAPANESE PATENT OFFICE

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 2005156215 A
 (43) Date of publication of application: 16.06.2005

(51) Int. Cl. G01N 23/223

(21) Application number: 2003391800

(22) Date of filing: 21.11.2003

(54) X-RAY FLUORESCENCE ANALYZER

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a wavelength dispersion type X-ray fluorescence analyzer capable of analyzing sufficiently accurately a micro measuring portion having 0.5mm or more to 4mm or less of diameter.

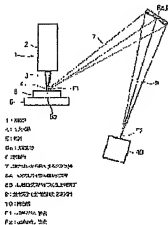
SOLUTION: In this X-ray fluorescence analyzer provided with an X-ray source 1 for emitting a beam-like primary X-ray 4 having 0.5 mm or more to 4 mm or less of diameter toward a sample 5 mounted on a sample block 6, a spectroscopic element 8A for dispersing spectrally a secondary X-ray 7 generated from the measuring portion 5a irradiated with the primary X-ray 4 in the sample 5, and a detector 10 for detecting a secondary X-ray 9 spectrally dispersed by the spectroscopic element 8A, the spectroscopic element 8A is a log spiral type spectroscopic element, one focal point F1 having an aberration is positioned in the measuring portion 5a, and the other focal point F2 having no aberration is positioned in a photoreception part of the

(71) Applicant: RIGAKU INDUSTRIAL CO

(72) Inventor: KAWAHARA NAOKI
 OGURA KEISUKE

detector 10.

COPYRIGHT: (C)2005,JPO&NCPI



Order Patent

JP 2005-156215 A 2005.6.16

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2005-156215

(P2005-156215A)

(43) 公開日 平成17年6月16日(2005.6.16)

(51) Int. Cl.⁷

G01N 23/22

F)

G01N 23/22

テーマコード(参考)

2G001

審査請求 準請求 請求項の点 2 Q.L. (全 5 頁)

(21) 出願番号	特開2003-301300 (P2003-301300)	(71) 出願人	000250351
(22) 出願日	平成15年11月21日(2003.11.21)		理光電機工業株式会社
		(74) 代理人	大塚府島地所弁士館町14番8号
			100067941
		(74) 代理人	弁士 杉本 修司
			100086783
		(74) 代理人	弁士 野田 健士
			100112629
		(74) 代理人	弁士 堀 健郎
		(72) 発明者	酒原 富貴
			大阪府高槻市赤木路町14番8号 理光電
			機工業株式会社内
		(72) 発明者	小倉 彰寿
			大阪府高槻市赤木路町14番8号 理光電
			機工業株式会社内
		Pターム(参考)	20001 AA01 BA04 GA01 BA02 BA20

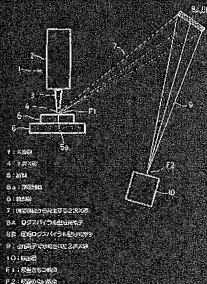
(54) 発明の名称 蛍光X線分析装置

(57) 【要約】

【課題】 直径φ、5mm以上4mm以下の微小な測定部位を十分正確に分析できる微長分散型蛍光X線分析装置を提供する。

【解決手段】 試料台6に設置された試料5に直径φ、5mm以上4mm以下の束状の1次X線4を照射するX線源1と、前記試料5において1次X線4が照射された測定部位5aから発生する2次X線7を分光する分光素子8と、その分光素子8から分光された2次X線9を検出する検出器10とを備えた蛍光X線分析装置であって、前記分光素子8Aがロジス/サイラ型分光素子であり、一方の収差をもつ焦点F1が前記試料5の測定部位5aに位置し、他方の収差のない焦点F2が前記検出器10の受光部に位置している。

【選択図】 図1



(2)

JP 2005-156215 A 2005.6.15

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

試料台上に載置された試料に直径0.5 mm以上4 mm以下の束状の1次X線を照射するX線源と、

前記試料において1次X線が照射された測定部位から発生する2次X線を分光する分光素子と、

その分光素子で分光された2次X線を検出する検出器とを備えた蛍光X線分析装置であって、

前記分光素子がログスバイラル型分光素子であり、一方の取差をもつ焦点が前記試料の測定部位に位置し、他方の取差のない焦点が前記検出器の受光部に位置している蛍光X線分析装置。 10

【請求項 2】

試料台上に載置された試料に直径0.5 mm以上4 mm以下の束状の1次X線を照射するX線源と、

前記試料において1次X線が照射された測定部位から発生する2次X線を分光する分光素子と、

その分光素子で分光された2次X線を検出する検出器とを備えた蛍光X線分析装置であって、

前記分光素子が回転ログスバイラル型分光素子であり、一方の取差をもつ焦点が前記試料の測定部位に位置し、他方の取差のない焦点が前記検出器の受光部に位置している蛍光X線分析装置。 20

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、試料の微小な測定部位を分析する波長分散型蛍光X線分析装置に関する。

【背景技術】

【0002】

従来、試料の直径数十μm以下のごく微小な測定部位を分析するEPMA (Electron Probe MicroAnalysis) においては集中法の光学系が用いられ、測定部位から発生する2次X線を分光する分光素子としてはログスバイラル型分光素子が用いられている。ログスバイラル型分光素子の2つの焦点のうち、一方は取差をもち、他方は取差がないので、取差をもつ焦点を適切な幅の発散スリットに位置させ、取差のない焦点を線状の受光スリットに位置させている (特許文献1参照)。このような配置により、ヨハン型分光素子を用いるよりも高い波長分解能を実現できる。 30

【0003】

また、試料の直径20 mm以上30 mm以下の測定部位を分析する波長分散型蛍光X線分析装置においても集中法の光学系が用いられ、測定部位から発生する2次X線を分光する分光素子としてはログスバイラル型分光素子が用いられている。ログスバイラル型分光素子の2つの焦点のうち、一方は取差をもち、他方は取差がないので、取差をもつ焦点を適切な幅の発散スリットに位置させ、取差のない焦点を線状の受光スリットに位置させている (特許文献1参照)。このような配置により、ヨハン型分光素子を用いるよりも高い波長分解能を実現できる。 40

【特許文献 1】特開平8-128975号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0004】

しかし、近年の美術品や半導体チップなどの分析における直径0.5 mm以上4 mm以下、特に直径2 mm以上3 mm以下の微小な測定部位に対しては、前者の従来技術では波長分解能、感度ともに不足し、後者の従来技術でも感度が不足するため、十分正確な分析が困難である。 50

(3)

JP 2005-156215 A 2005.6.15

【0005】

本発明は、このような問題に鑑みてなされたもので、直径0.5mm以上4mm以下の微小な測定部位を十分正確に分析できる波長分散型蛍光X線分析装置を提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

【0006】

前記目的を達成するために、本発明の第1構成にかかる蛍光X線分析装置は、試料台に載置された試料に直径0.5mm以上4mm以下の束状の1次X線を照射するX線源と、前記試料において1次X線が照射された測定部位から発生する2次X線を分光する分光素子と、その分光素子で分光された2次X線を検出する検出器とを備えている。そして、前記分光素子がログスバイラル型分光素子であり、一方の取差をもつ焦点が前記試料の測定部位に位置し、他方の取差のない焦点が前記検出器の受光部に位置している。

【0007】

第1構成の蛍光X線分光装置によれば、ログスバイラル型分光素子の取差をもつ焦点に試料の測定部位を位置させて、測定部位の大きさに応じた束状の1次X線を照射し、発散スリットを用いずに、測定部位から発生する2次X線を直接ログスバイラル型分光素子に入射させるので、波長分解能および感度が不足することなく、直径0.5mm以上4mm以下の微小な測定部位を十分正確に分析できる。

【0008】

本発明の第2構成にかかる蛍光X線分析装置は、第1構成におけるログスバイラル型分光素子を回転ログスバイラル型分光素子に代えたものである。第2構成の蛍光X線分光装置によっても、第1構成と同様の作用効果が得られる。

【発明を実施するための最良の形態】

【0009】

以下、本発明の第1実施形態の蛍光X線分析装置を図面に示したかゝって説明する。この装置は、図1に示すように、試料台6に載置された試料5に直径0.5mm以上4mm以下、例えば直径2mmの束状の1次X線4を照射するX線源1と、試料5において1次X線4が照射された測定部位5aから発生する蛍光X線などの2次X線7を分光する分光素子8Aと、その分光素子8Aで分光された2次X線9を検出する検出器10とを備えている。

【0010】

X線源1は、X線管2とコリメータ3からなっている。コリメータ3は、シングルコリメータ、マルチコリメータのいずれでもよく、また、コリメータ3に代えてピンホールを用いてもよい。ここでは、束状の1次X線4は、試料5に向かって先細になっており、直径2mmと、試料5の表面での大きさをいう。つまり、このX線源1は、測定部位5aの直径が2mmである試料5に対応したものであるが、コリメータ3を交換することにより、他の直径の測定部位にも対応できる。なお、測定部位とは、測定しようとする範囲の試料表面およびその深さ方向への近傍である。

【0011】

分光素子8Aはログスバイラル型分光素子で、図では鉄面に沿う断面で示しており、受光面は、断面形状であるログスバイラルカーブが紙面垂直方向に延びたものである。一方の取差をもつ焦点F1が試料の測定部位5aに位置し、他方の取差のない焦点F2が検出器10の受光部に位置している。

【0012】

第1実施形態の蛍光X線分光装置によれば、ログスバイラル型分光素子8Aの取差をもつ焦点F1に試料5の測定部位5aを位置させて、測定部位5aの大きさに応じた束状の1次X線4を照射し、発散スリットを用いずに、測定部位5aから発生する蛍光X線などの2次X線7を直接ログスバイラル型分光素子8Aに入射させるので、波長分解能および感度が不足することなく、直径0.5mm以上4mm以下の微小な測定部位5aを十分正確に分析できる。

(4)

JP 2005-156715 A 2005.6.16

【0013】

次に、本発明の第2実施形態の蛍光X線分析装置について説明する。第2実施形態の装置は、第1実施形態におけるログスパイラル型分光素子8Aを回転ログスパイラル型分光素子8Bに代えたものである。回転ログスパイラル型分光素子8Bは図1のように紙面に沿う断面ではログスパイラル型分光素子8Aと同じになるが、受光面は、断面形状であるログスパイラルカーブが2つの焦点F1、F2を結ぶ直線を軸として回転したものである。

【0014】

ログスパイラル型分光素子8Aでは、分光後の2次X線9は、紙面垂直方向に延びる線状の焦点F2に向かいつつ、紙面垂直方向には拡散するのに対し、回転ログスパイラル型分光素子8Bでは、分光後の2次X線9は、点状の焦点F2に向かいつつ、紙面垂直方向にも集光する。したがって、第2実施形態の装置によっても、少なくとも第1実施形態と同様の作用効果が得られ、さらに分光した2次X線9を点状に集光するので、感度をいっそう向上しうる。

【図面の簡単な説明】

【0015】

【図1】 本発明の第1、第2実施形態の蛍光X線分析装置を示す概略図である。

【符号の説明】

【0016】

- 1 X線源
- 4 1次X線
- 5 試料
- 5a 測定部位
- 6 試料台
- 7 測定部位から発生する2次X線
- 8A ログスパイラル型分光素子
- 8B 回転ログスパイラル型分光素子
- 9 分光素子で分光された2次X線
- 10 検出器
- F1 収差をもつ焦点
- F2 収差のない焦点

20

30

(5)

JP 2005-156715 A 2005.6.16

【図 1】

